【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成26年12月25日(2014.12.25)

【公開番号】特開2013-125136(P2013-125136A)
【公開日】平成25年6月24日(2013.6.24)
【年通号数】公開・登録公報2013-033
【出願番号】特願2011-273548(P2011-273548)
【国際特許分類】
Ｇ０９Ｆ　9/30　(2006.01)
Ｇ０９Ｆ　9/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０９Ｆ　9/30　３１０
Ｇ０９Ｆ　9/00　３４２Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成26年11月11日(2014.11.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
【図１】本開示の一実施の形態に係る表示装置の構成を表す断面図である。
【図２】図１に示した基板の構成を表す図である。
【図３】図２に示した基板の製造方法を工程順に表す断面図である。
【図４】図３に続く工程の一例を表す断面図である。
【図５】図３に続く工程の他の例を表す断面図である。
【図６】比較例に係る基板の製造方法を工程順に表す断面図である。
【図７】図３に示した工程について説明するための断面図である。
【図８】図７に続く工程を表す断面図である。
【図９】適用例１の外観を表す斜視図である。
【図１０】適用例２の外観を表す斜視図である。
【図１１】（Ａ）は適用例３の表側から見た外観を表す斜視図、（Ｂ）は裏側から見た外観を表す斜視図である。
【図１２】適用例４の外観を表す斜視図である。
【図１３】適用例５の外観を表す斜視図である。
【図１４】（Ａ）は適用例６の開いた状態の正面図、（Ｂ）はその側面、（Ｃ）は閉じた状態の正面図、（Ｄ）は左側面図、（Ｅ）は右側面図、（Ｆ）は上面図、（Ｇ）は下面図である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
基板１１とＴＦＴ層１２との間に、ＴＦＴ層１２および表示層２０の水分や有機ガスによる劣化を防止するため、バリア層（図示せず）を設けるようにしてもよい。このバリア層は、基板１１の平坦性が増すことによりカバレッジが大きくなり、バリア性が向上する。バリア層は、例えばAlO_xN_{1-X}（ただし、Ｘ＝０．０１～０．２）または窒化シリコ

ン（Si_3N_4）からなる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
表示層２０は駆動基板１０と対向基板３０との間に設けられ、駆動基板１０のＴＦＴ層１２により駆動される。表示層２０は、例えば駆動基板１０側の画素電極と対向基板３０側の共通電極との間に表示体を有している。この表示体は、例えば、液晶層、有機ＥＬ（Electroluminescence）層、無機ＥＬ層あるいは電気泳動型の表示素子等である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
以上、実施の形態を挙げて本技術を説明したが、本技術は上記実施の形態等に限定されるものではなく、種々変形が可能である。例えば、上記実施の形態等では、表示装置１がＴＦＴ層１２を有するアクティブマトリクス型の場合について説明したが、パッシブマトリクス型であってもよい。